

ID	装置名	Equipment
NM-001	NMR(ECS-400)	NMR(ECS-400)
NM-002	LC-MS(Q-Exactive Plus)	LC-MS(Q-Exactive Plus)
NM-003	ラマン顕微鏡(inVia Reflex)	Raman microscope(inVia Reflex)
NM-004	共焦点レーザー走査型蛍光顕微鏡(SP5)	Confocal laser scanning fluorescence microscope(SP5)
NM-005	液中原子間力顕微鏡(NanoWizard 4 XP)	Atomic force microscope (AFM) in liquid(NanoWizard 4 XP)
NM-006	卓上走査型電子顕微鏡装置群(TM4000PlusII, TM3000)	Tabletop scanning electron microscope (SEM)(TM4000PlusII, TM3000)
NM-007	表面プラズモン共鳴装置(Biacore X100)	Surface plasmon resonance (SPR) instrument(Biacore X100)
NM-008	プレートリーダー(EnSight)	Plate reader(EnSight)
NM-009	分光光度計(U-2900)	Spectrophotometer(U-2900)
NM-010	分光蛍光光度計(F-7000)	Fluorescence spectrophotometer(F-7000)
NM-011	フーリエ変換赤外分光光度計(IRTTracer-100)	FT-IR(IRTTracer-100)
NM-012	円二色性分散計(J-725)	Circular dichroism (CD)(J-725)
NM-013	ゼータ電位計(ELSZ-1000Z)	Zeta potential analyzer(ELSZ-1000Z)
NM-014	動的光散乱光度計(DLS-8000HAL)	Dynamic light scattering (DLS) spectrophotometer(DLS-8000HAL)
NM-015	粒度分布測定装置(SALD-2100)	Particle size analyzer(SALD-2100)
NM-016	接触角計(VCA Optima-XE)	Contact angle meter(VCA Optima-XE)
NM-017	テクスチャーアナライザー(TA-XT2i)	Texture analyzer(TA-XT2i)
NM-018	HPLC(質量分析計付き)(Prominence LXQ)	HPLC with MS(Prominence LXQ)
NM-019	ゲル浸透クロマトグラフィー装置群(Nexera40, DAWN 8, GPC-101)	Gel permeation chromatography (GPC)(Nexera40, DAWN 8, GPC-101)
NM-101	500MHz固体汎用NMRシステム(JNM-ECA 500)	500 MHz Solid-State NMR (I)(JNM-ECA 500)
NM-102	500MHz固体高分解能NMRシステム(JNM-ECZ500R)	500 MHz Solid-State NMR (II)(JNM-ECZ500R)
NM-103	800MHzナローボア固体高分解能NMRシステム(JNM-ECA800)	800 MHz Solid-State high-resolution NMR(JNM-ECA800)
NM-104	800MHzワイドボア固体高分解能NMRシステム (JNM-ECZ800R)	800 MHz wide bore Solid-State NMR(JNM-ECZ800R)
NM-201	多環境場対応型X線単結晶構造解析装置(XtaLAB Synergy-R/DW Custom)	Single Crystal X-ray Diffractometer for Multiple Environments(XtaLAB Synergy-R/DW Custom)
NM-202	走査型デュアルX線光電子分光分析(HAX-PES/XPS)(Quantes)	Dual Scanning X-ray Photoelectron Microprobe Equipped with Hard X-Ray(HAX-PES/XPS)(Quantes)
NM-203	誘導結合プラズマ発光分析装置群(1. 720 ICP-OES 2. Agilent5800 3. Agilent7850 4. SPS3520DD-UV 5. Element XR)	Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometers / Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometers(1. 720 ICP-OES 2. Agilent5800 3. Agilent7850 4. SPS3520DD-UV 5. Element XR)
NM-204	高輝度・高感度型粉末X線回折装置(SmartLab 9 kW)	High-power and high-sensitivity type powder X-ray diffractometer (SmartLab 9 kW)
NM-205	飛行時間型二次イオン質量分析装置(PHI TRIFT V nanoTOF)	Time-of-flight Secondary Ion Mass Spectrometry (TOF-SIMS)(PHI TRIFT V nanoTOF)
NM-206	酸素窒素水素分析装置(OXH836)、炭素硫黄分析装置(CS844)	Oxygen/Nitrogen/Hydrogen Analyzer(OXH836), Carbon/Sulfur Analyzer(CS844)
NM-207	電界放出形電子線プローブマイクロアナライザー装置(JXA-8500F)	Field Emission Electron Probe Micro-Analyzer (FE-EPMA)(JXA-8500F)
NM-208	走査型オージェ電子分光分析装置(JAMP-9500F)	Scanning Auger Electron Microprobe (CHA Type AES)(JAMP-9500F)
NM-301	広空間・高分解能分析電子顕微鏡 ベーシック利用(JEM-ARM300F)	Analytical transmission electron microscope Basic Use(JEM-ARM300F)
NM-301	広空間・高分解能分析電子顕微鏡 アドバンス利用(JEM-ARM300F)	Analytical transmission electron microscope Advanced Use(JEM-ARM300F)
NM-302	微細組織3次元マルチスケール解析装置(SMF-1000)	Orthogonal FIB-SEM(SMF-1000)
NM-401	300kV収差補正電子顕微鏡 ベーシック利用(JEM-ARM300F)	Analytical apparatus for electron beam sensitive materials Basic Use(JEM-ARM300F)
NM-401	300kV収差補正電子顕微鏡 アドバンス利用(JEM-ARM300F)	Analytical apparatus for electron beam sensitive materials Advanced Use(JEM-ARM300F)
NM-402	単原子分析電子顕微鏡(FEI Titan Cubed)	Atomic-resolution analytical electron microscope(FEI Titan Cubed)
NM-403	TEM試料自動作製FIB-SEM複合装置(NX5000)	FIB-SEM combined apparatus for automatic preparation of TEM specimens(NX5000)
NM-404	無損傷電子顕微鏡試料薄片化装置(Model 1040 Nanomill)	Damage-less TEM specimen milling apparatus(Model 1040 Nanomill)
NM-407	セラミックス試料作製装置群	Ceramics sample preparation facilities
NM-408	200kV透過電子顕微鏡 (Talos F200X G2)	200kV transmission electron microscope(Talos F200X G2)
NM-501	実動環境対応物理分析電子顕微鏡(JEM-ARM200F-G)	Real working environment physical characterization TEM(JEM-ARM200F-G)
NM-502	実動環境対応電子線ホログラフィー電子顕微鏡(JEM-ARM200F-B)	Real working environmental electron holography microscope(JEM-ARM200F-B)
NM-503	200kV電界放出形透過電子顕微鏡1(JEM-2100F1)	200kV field emission transmission electron microscope1(JEM-2100F1)
NM-504	200kV電界放出形透過電子顕微鏡2(JEM-2100F2)	200kV field emission transmission electron microscope2(JEM-2100F2)
NM-505	200kV透過電子顕微鏡(JEM-2100)	200kV transmission electron microscope(JEM-2100)
NM-506	2軸傾斜バイアス印加・加熱TEM試料ホルダー(Lightning)	Double-tilt bias and heating TEM holder(Lightning)
NM-507	2軸傾斜液体窒素冷却TEM試料ホルダー(Gatan 636)	Double-tilt LN2 cryo TEM holder(Gatan 636)
NM-508	走査型電子顕微鏡(JSM-7000F)	Field emission scanning electron microscope(JSM-7000F)
NM-509	デュアルビーム加工観察装置(NB5000)	Dual Beam system(NB5000)
NM-510	FIB加工装置1(JIB-4000)	Focused Ion Beam system1(JIB-4000)
NM-511	FIB加工装置2(JEM-9320FIB)	Focused Ion Beam system2(JEM-9320FIB)
NM-512	FIB加工装置3(JEM-9310FIB)	Focused Ion Beam system3(JEM-9310FIB)
NM-513	ピックアップシステム(Pick-up System)	Pick-up System
NM-514	ウルトラマイクローム(Leica EM UC6)	Ultramicrotome(Leica EM UC6)
NM-515	電子線トモグラフィー解析システム(Electron tomography analysis system)	Electron tomography analysis system
NM-516	TEM試料作製装置群	TEM sample preparation apparatus

ID	装置名	Equipment
NM-661	電子ビーム描画装置 [JBX-8100FS]	EB Lithography [JBX-8100FS]
NM-601	電子ビーム描画装置 [ELS-F125]	EB Lithography [ELS-F125]
NM-635	電子ビーム描画装置 [ELS-BODEN100]	EB Lithography [ELS-BODEN100]
NM-603	レーザー描画装置 [DWL66+]	Laser Lithography [DWL66+]
NM-636	マスクレス露光装置 [DL-1000]	Maskless Lithography [DL-1000]
NM-604	マスクレス露光装置 [DL-1000/NC2P]	Maskless Lithography [DL-1000/NC2P]
NM-660	マスクレス露光装置 [MLA150]	Maskless Lithography [MLA150]
NM-637	マスクアライナー [MA-6]	Mask Aligner [MA-6]
NM-605	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #1]	H2O Plasma Cleaner [AQ-500 #1]
NM-638	水蒸気プラズマ洗浄装置 [AQ-500 #2]	H2O Plasma Cleaner [AQ-500 #2]
NM-606	UVオゾンクリーナー [UV-1]	UV Ozone Cleaner [UV-1]
NM-608	スパッタ装置 [JSP-8000]	Sputter [JSP-8000]
NM-641	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #2]	Sputter [CFS-4EP-LL #2]
NM-607	スパッタ装置 [CFS-4EP-LL #3]	Sputter [CFS-4EP-LL #3]
NM-610	電子銃型蒸着装置 [RDEB-1206K]	EB Evaporator [RDEB-1206K]
NM-609	電子銃型蒸着装置 [ADS-E86]	EB Evaporator [ADS-E86]
NM-642	電子銃型蒸着装置 [MB-501010]	EB Evaporator [MB-501010]
NM-643	電子銃型蒸着装置 [UEP-3000BS]	EB Evaporator [UEP-3000BS]
NM-644	原子層堆積装置 [SUNALE R-150]	ALD [SUNALE R-150]
NM-611	原子層堆積装置 [AD-230LP]	ALD [AD-230LP]
NM-633	SiO2プラズマCVD装置 [PD-220NL]	SiO2 PECVD [PD-220NL]
NM-612	SiNプラズマCVD装置 [PD-220NL]	SiN PECVD [PD-220NL]
NM-613	リフトオフ装置 [KLO-150CBU]	Auto Lift-Off [KLO-150CBU]
NM-614	CCP-RIE装置 [RIE-200NL]	CCP-RIE [RIE-200NL]
NM-615	ICP-RIE装置 [RIE-101iPH]	ICP-RIE [RIE-101iPH]
NM-617	ICP-RIE装置 [RV-APS-SE]	ICP-RIE [RV-APS-SE]
NM-645	ICP-RIE装置 [CE300I]	ICP-RIE [CE300I]
NM-616	シリコンDRIE装置 [ASE-SRE]	Si Deep RIE [ASE-SRE]
NM-618	原子層エッチング装置 [PlasmaPro 100 ALE]	ALE [PlasmaPro 100 ALE]
NM-646	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #1]	RTA [RTP-6 #1]
NM-619	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #2]	RTA [RTP-6 #2]
NM-634	赤外線ランプ加熱装置 [RTP-6 #3]	RTA [RTP-6 #3]
NM-621	FE-SEM [S-4800]	FE-SEM [S-4800]
NM-647	FE-SEM+EDX [S-4800]	FE-SEM+EDX [S-4800]
NM-648	FE-SEM+EDX [SU8000]	FE-SEM+EDX [SU8000]
NM-649	FE-SEM+EDX [SU8230]	FE-SEM+EDX [SU8230]
NM-650	卓上電子顕微鏡 [TM3000]	Tabletop SEM+EDX [TM3000]
NM-622	走査型プローブ顕微鏡 [Jupiter XR]	SPM [Jupiter XR]
NM-651	走査型プローブ顕微鏡 [L-trace]	SPM [L-trace]
NM-652	走査型プローブ顕微鏡 [Nanoscope5]	SPM [Nanoscope5]
NM-623	レーザー顕微鏡 [LEXT OLS4000]	Laser Microscope [LEXT OLS4000]
NM-653	レーザー顕微鏡 [VK-9700]	Laser Microscope [VK-9700]
NM-627	イオンスパッタ [E-1045]	Ion Sputter [E-1045]
NM-626	触針式プロファイラー [Dektak XT-A]	Surface Profilometer [Dektak XT-A]
NM-654	触針式プロファイラー [Dektak 6M]	Surface Profilometer [Dektak 6M]
NM-625	エリプソメーター [MARY-102FM]	Ellipsometer [MARY-102FM]
NM-655	分光エリプソメーター [M2000]	Spectroscopic Ellipsometer [M2000]
NM-624	顕微分光膜厚計 [F54-XY-200-UV]	Optical Film Mapper [F54-XY-200-UV]
NM-628	薄膜応力測定装置 [FLX-2000-A]	Thin-Film Stress Tester [FLX-2000-A]
NM-629	ダイシングソー [DAD322]	Dicing Saw [DAD322]
NM-656	ダイシングソー [DAD3220]	Dicing Saw [DAD3220]
NM-630	室温プローバー [MX-200/B]	Room Temp. Prober [MX-200/B]
NM-657	室温プローバー [HMP-400]	Room Temp. Prober [HMP-400]
NM-658	低温プローバー [GRAIL-408-32-B]	Low Temp. Prober [GRAIL-408-32-B]
NM-631	液体窒素プローバー [SB-LN2]	Liquid N2 Prober [SB-LN2]
NM-659	ワイヤーボンダー [7476D #1]	Wire Bonder [7476D #1]
NM-632	ワイヤーボンダー [7476D #2]	Wire Bonder [7476D #2]